科学研究費助成事業(科学研究費補助金)研究成果報告書

平成 24 年 6月 22 日現在

機関番号:33811
研究種目:基盤研究 A(一般)
研究期間:平成 21 年度~平成 23 年度
課題番号:21244088
研究課題名(和文)レーザー加速電子によるレーザー光の逆コンプトン散乱エックス線発
生と遠隔透視応用
研究課題名(英文) Inverse Compton X-rays from laser-accelerated electron
bunches sand its industrial application

研究代表者

北川 米喜(KITAGAWA YONEYOSHI) 光産業創成大学院大学・光産業創成研究科・教授 研究者番号:40093405

研究成果の概要(和文):本研究の目的は,超高強度レーザー加速電子によるレーザー光自身の逆 コンプトン散乱X線を開発し,それを用いて,後方散乱遠隔透視法の実証を行うことである.現有 の3TW超高強度レーザーレーザーの2段の立体構成による小型化と出力増強(出力1J,パルス幅100 fs)の結果,世界初でレーザー加速準単色電子ビームバンチによる6及び11keVの逆コンプトン X線発生に成功し,結果はApplied Physics Express 5 (2012) 056401に掲載.米国物理学会,プラズ マ核融合学会年会でも報告した.遠隔透視技術の実用化のため調査研究を開始した.

研究成果の概要(英文): Inverse Compton X-rays from laser-accelerated monoenergetic electrons are observed. A Ti:sapphire laser (pulse energy: 500 mJ; pulse width: 150 fs) beam is divided into two beams to accelerate electrons to energies of 13 and 22 MeV, which inversely scattered the secondary laser beam into 6 and 11 keV X-rays. This demonstrates a novel source of monoenergetic directional ultrashort X-ray pulses (Applied Physics Express **5** (2012) 056401).

交付決定額

			(金額単位:円)
	直接経費	間接経費	合 計
21 年度	19, 700, 000	5, 910, 000	25, 610, 000
22 年度	11, 400, 000	3, 420, 000	14, 820, 000
23 年度	5, 800, 000	1, 740, 000	7, 540, 000
年度			
年度			
総計	36, 900, 000	11, 070, 000	47, 970, 000

研究分野:数物系科学

科研費の分科・細目:プラズマ科学

キーワード:超高強度レーザー, 逆コンプトン散乱, 遠隔透視, 単色電子ビーム, レーザー加速

1. 研究開始当初の背景

空港,港湾等の巨大施設の安全対策,爆発物, 麻薬,銃器など不審物の非破壊検査で検査員 の安全のため に遠隔後方探査,また災害現 場の埋没者探査などでも遠隔後方探査しか, 方法がない.ただ,それに適した線源がなく, その開発が緊急課題となっている.この手法 は、死角の交差点からの車の飛び出し確認 にもそのまま応用できる.その適性は、(1)不 審物からの危険の及ばない程度離れて検査で きること、(2)線源と検出器が同一場所にあ ることである.



図 1: 冬山遭難時後方散乱 X 線透視イメージ

現在の手荷物検査など非破壊検査装置は、不 審物にほぼ接触し,かつ検出器は対向側にし か置けない. 先ず(1)の条件を満たすには, たとえば、10m離れると現在の手荷物検査の 線源だと、その1000 倍の強度が必要となり、 検査物以外への影響があり過ぎて使えない. コンプトン散乱の様に方向性を持った線源の みが残る. (2)の条件を満たすには、不審物 からの後方散乱X線を検出することになる. 散乱光はまた、入射光の1000分の一程度なの で,検出器は背景の宇宙線雑音に隠れて検出 が困難となる.これらの理由で今まで実証さ れていない.其の程度の微弱光でも、ピコ秒以 下の超短時間パルスなら,同期計測により検 出可能となろう.従って超高強度レーザー加 速電子によるレーザー光自身のコンプトン散 乱 X 線を用いる後方散乱光が唯一の解と考 えられる.



図 2: 後方散乱 X 線透視実証実験

申請者は、これまでに、超高強度超短パルス レーザーで発生した制動X線をアルミニウム ケースの中に封じた銅、鉛、アクリルに照射 し、自然放射能レベル以下の微弱な乱光を入 射X線との同期計測で、その材質、形状の推 測ができることを示した、実験配置は図1の ようであり、検出器からの距離は15cm.結果 を図2に示す:参考文献 [1,2,3].わずか 1TWの低強度レーザーではあるが、同期計測 により10000 ショット(100秒)連続計測によっ て、クリヤーな後方散乱光が取得出来ること を初めて示した.レーザーターゲットからほ ぼ全立体角に放出されるX線を,鉛窓で区切 って 線源とした.



図 2: a:Al ケース内のアクリルと銅の後方透視, b: アクリルと鉛の場合

図2に示すのは、後方散乱X線の強度分布で あるが、被散乱物質の材質に依存して、図3 のように散乱スペクトルが入射スペクトル から変形されるので、これら強度分布とスペ クトルから、物質の特定が可能となることも 示した.



図3.特定物質による散乱スペクトルの変化

(2). 学術的特色, 独創性, 予想される結果, 意義:

レーザー光による逆コンプトン散乱光の開 発は、電子ビーム源として SPring 8などの大 型の加速器 を用いて試みられている.しか しレーザーが小型化しても電子線源が小型化 しない限り. コンプトン光 の応用はその場 所に限られる. そこでテーブルトップレーザ ーの粒子加速法高速電子により、そのレー ザー光自身の逆コンプトン散乱光を作りだせ れば、コンパクトな理想的線源が可能となる。 最近、レーザー粒子加速が実証段階から応用 段階に入りつつあり,かなり安定な電子ビー ム源と看做なせる所にきた. コンプトン散乱 ではないが, 英国では, 准単色 64 MeV レー ザー電子ビームをウィグラー磁場に通して、 波長 740 nm のシンクロトロン放射光を得た [4]. レーザー加速粒子が放射光源としての可 能性を 示したことは、申請者らの遠隔透視 の結果とともに画期的なことである.

レーザー加速電子による逆コンプトン X 線は、ドイツから文献5にあるように、全光 学系と称して本研究と同じく1ビームの超 高強度レーザーを対向2ビームに分けて、 一方で発生した電子ビームで他方向から のレーザー光をトムソン散乱させて、逆コ ンプトン光を得ている。本研究の成果とと もに、レー ザー加速粒子の産業応用に更に 接近すると思われる.

参考文献

[1] H. KUWABARA, Y. MORI, Y. KITAGAWA, "Coincident Measurement of a Weakly Backscattered X- ray with a CPA Laser-Produced X-ray Pulse", Plasma and Fusion Research: Rapid Communications 3, 003-004 (2008).
[2] 北川米喜, "レーザー粒子加速, その原理と 展望"光学 37, No. 11 (2008).
[3] Y. Kitagawa et al., "Ultra-intense Laser Applications to the Industries at GPI", Proc. 2008 AAC Workshop, AIP Conference Proceedings, 2008 to be published.
[4] H. P. Schlenvoigt et al, "A compact synchrotron radiation source driven by a laser-plasma wakefield accelerator", nature physics, Nat. Phys. 4 (2008) 130.
[5] H. Schwoerer, B. Liesfeld, H.-P. Schlenvoigt, K.-U. Amthor, and R.Sauerbrey: Phys. Rev. Lett. 96 (2006) 014802.

2. 研究の目的

本研究の目的は,超高強度レーザー加速電 子による,レーザー光自身の逆コンプトン散 乱 X 線を開発し,それを用いて,後方散乱遠 隔透視法の実証を行うことである.

特に産業応用として有用な、レーザー加速 で生成される単色電子ビームによる逆コン プトン散乱X線を開発することを一つの目的 とする.

前節で述べたように、世界的にレーザー 加速電子ビームの応用が考え始められてい るが、レーザー加速ビームの特色は、スポッ ト光源、短パルスの特徴、そして単色電子ビ ームである.それらを有効に使う事はどこで も行われていない.ここではその応用を目指 す.

3.研究の方法

目標値を表 1 に掲げる.本研究の初年度 から次年度にかけては,現有の 3TW 超高強 度レーザー光を増強し2本にわけ,対向 180° 乃至 150°照射配位とした.一方のレーザー光 は 30 度傾けた固体平板ターゲットに照射し, 高速電子をターゲット後方法線方向に放出

A THE MAN THE MOTO TO THE	表	1:	最終	目標	@10	m
---------------------------	---	----	----	----	-----	---

発散角	$0.25 \mathrm{~mrad}$
総 X 線光子数	$1 \times 10^6 / \mathrm{pulse}$
X 線エネルギー	$100 \mathrm{keV}$
繰り返し	10 Hz

させる.他方のレーザー光をこの電子ビーム と逆方向に照射し,逆コンプトン散乱により, 電子ビームによる後方散乱光(X 線)を発生さ せ,その集光性能を評価する.次年度から3 年度には,現有発振器(80f パルス幅,2 台)の 1 台を 30 fs パルス発振器とし,准単色電子 ビーム(完全なモノエネルギーではないが, ほぼ単色に近いスペクトルを持った電子ビ ーム)によるコンプトン光の強度を増強を図 り,遠隔透視の実証を行った.

最終年度で、1m 程度離れた距離での実証を 試みる. 従って、表 1 より光子数は、1/100 と して、65 MeV 電子による 100keV X 線の 10⁴ 光子/pulse の発生を試みた.

テーブルトップのチタンサファイヤレー ザーレーザーを元にして、光学的パラメトリ ックチャープ増幅方式により 4TW のビート レーザー(エネルギー500 mJ, パルス半値全 幅 150 fs, 波長 815ns)を構築した。それを超音 速スリットノズルから吹き出したガス密度



図4.(上)のレーザー光による逆コンプトン散乱実 験配位.(左下)プローブ光干渉法による密度分布. (右下)レーザー軸方向の位相分布とそれを密度分 布になおしたもの.Zはレーザー軸方向に沿った 距離である.

9x10¹⁹/cm³のヘリウムガスに照射した。

図4中のビームスプリッターで460 mJの反 射ビーム(1次ビーム)と30 mJの透過ビーム(2 次ビーム)に分け、反射ビームで航跡場を励起 し、電子ビームを加速する.このビームは焦 点距離108 mm (f/2.2),口径30 mmの軸外し 放物面鏡で、ガスジェットの一方の端にノズ ルの下方2mmの位置で集光する.ジェット ノズルスリットは長さ4mm幅1.2 mmの長方 形の開口を持ち、長手方向をレーザー軸と平 行とする.その位置関係を図5 に示す.下図

は集光点付近の拡大図である.



図5. ガスジェット形状とレーザー集光位置関係.

集光強度は1.5x10¹⁸ W/cm²である.もう一方の ビームは焦点距離150 mm (f/3.8), 口径かんし ょ150 mmの凸レンズで他端に集光する. 集光 強度は91.5 x10¹⁵ W/cm²である. 規格化ベクト ルポテンシャル

$$a_0 = eE/m_e\omega_{Lc} \tag{1}$$

はそれぞれ0.84と0.064となる. 但しEは電場、 m_e は電子質量、 ω_{Le} はレーザーの角周波数である.2次ビームのスポットサイズは32 μ mであるが、その13%に36 mJが含まれる. 上記ビームのパルス圧縮器内での漏れ光を2 倍高調波(407nm)に波長変換し、1次ビーム と直交する方向からヘリウムガスに照射し、 透過光をシェアリング干渉法で検出した.



図6. シェアリング干渉計配位

計測システムを図6に示す。プローブビームは、 ピンホールを通す。干渉計は当初マッハツェ ンダー型を構築したが、アライメント及び干 渉縞の制御が困難であった。従来の干渉シス テムで使用するレーザーと比較して、ビート レーザーのパルス幅が150fsと短いため、コヒ ーレント長さが短いためである。そこで、シ ェアリング干渉計に変更した結果、フリンジ シフト幅の調整が可能となった。



図7. 干渉縞解析ソフトGUI画面

干渉縞解析のために、新たにGUIベースで処 理可能な干渉縞解析ソフトを構築した。解析 ソフトのGUI画面を図7に示す。本ソフトウェ アでは、TIFF形式画像データより、干渉縞間 隔を読み取り、振幅情報と位相情報を算出す る。 位相情報については、位相の飛びを検出 するアンラップ機能が搭載されており、フリ ンジシフト量が瞬時に求まる。従来、解析に 数時間以上費やしていた作業が1分以内で可 能となったため、実験効率が向上した。 信号をアーベル変換したものが、図4の下図で ある.電子ビーム発生の最適ガス流束はガス 溜め圧力が80 atm の時に得られる. その時、 1次ビームがちょうど流束の出口端に掛かる ようにする. 即ち1次ビームと2次ビームの 時間差を3.3psととると、この点で、二つのビ ームをちょうど出会う.

アーベル変換の結果、プラズマ中心で電子 密度は3x10¹⁹ cm⁻³であった。航跡場は、

$$\mathbf{a}_{0}^{2}/(1 + \mathbf{a}_{0}^{2})^{1/2} (\mathbf{m}_{ec} \boldsymbol{\omega}_{p})/\mathbf{e} = 97 \text{ MV}$$
 (2)

と評価でき、加速長 dephasing length は

$$\gamma^2 \phi \lambda p (1 + a_0^2)^{1/2} = 0.45 \text{ mm}$$
 (3)

となる. ここで $\gamma^2 \phi$ = nc/ne=58, λ pはプラズマ 波長6 µm, ncは遮断密度で1.7 x10²¹/cm³である.



図 8. プラズマ電子密度分布

図4右下を再度図8にプロットする。 z=600 μ m付近にプラズマ密度のくぼみが あることがわかる。ここは、レーザーパル スが丁度到達している点と一致する。プロ ーブパルスのパルス幅が100fsであるため、 空間分解能は 30μ mである。くぼみの深さ と幅はそれぞれ(1.6±0.8)x10¹⁹ cm⁻³、130 ± 30μ mであった。

このくぼみは80気圧未満のガスパフ圧力 では観測されなかった。また、このくぼみ が観測された条件下において、高品質電子 ビームの特徴の一つであるエネルギー準単 色化(図6)に成功した。故に、このくぼみは 単色電子ビーム発生時にシミュレーション で予言されているプラズマバブル構造を実 験的に検証した可能性がある。

4. 研究成果

散乱される入射レーザー光のフォトンエ ネルギー&_Lと散乱させる電子ビームのエネ ルギーγに対して、逆コンプトン散乱光のエ ネルギーは、

$$E_r = \frac{4\gamma^2 \varepsilon_L}{1 + (\gamma \theta)^2 + 4\gamma \varepsilon_L / (m_e c^2)}$$
(4)

と与えられる.

今、入射レーザー光の波長は、800nm でエ ネルギーに換算すると 1.5 eV である.電子 ビームのエネルギーは最大 50 MeV とすると、 γはせいぜい100下それ以下である.従っ てこの式の分母の第3項は、散乱光のエネル ギーと電子の静止エネルギー511keV との比 で、この実験ではほぼ無視できる。



図 9. 光から逆 Compton 光への変換

電子ビーム方向のみに注目すると散乱角度0 はゼロのオーダーなので、この項も無視でき て

$$E_r \sim 4\gamma^2 \varepsilon_L \tag{5}$$

としてよい. これを図9にプロットする.その時散乱角は

$$\theta \approx \frac{1}{\gamma}$$
 (6)

となるので、電子ビームのエネルギーγ が大きければ大きいほど、散乱角は小さく ペンシルビームのように絞り込むことが出 来る。これが応用上逆コンプトン散乱光の 最大の利点といえる. γ= 100なら

$$\theta = 1/100 = 0.3^{\circ} \tag{7}$$

である.

(1) 実際レーザー照射配位

図4のようにレーザー光を対向させ、一方の レーザーでガスジェット内に航跡場という 相対論的位相速度をもつプラズマ波を励起 する.図10が実際の配位で下側の軸外し放





図11. 真空容器内のレーザー対向照射配位の実際 写真

物面鏡(OAP)で集光する.図 11 は実際の写真 で図 10 と同じ方向からみたものである.

(2) 電子ビーム計測



図 12. 電子スペクトルのガスジェット背圧依存性. (上) IP フィルム上の電子スペクトル。上端はエ

ネルギーゼロ、下端が29 MeV に対応する。(下) 横軸エネルギーに再プロットしたもの.赤:生デ ータ、緑:背景ノイズ、青:正味電子スペクトル.

航跡場によって加速された電子ビームのエ ネルギースペクトルを計測するために電子 スペクトルメーター(ESM)をこのレーザーの 下流に設置した。ダイポール磁場でエネルギ ー分解した電子スペクトルをイメージング プレート(IP)に記録するもので,検出立体 角は、3.1x10⁻⁴ str で、最大 29 MeV まで検 出可能である. IP から読み取ったものが図 12 である. 左はガスジェットの背圧が 65 atm, 右は 80 atm の時でそれぞれ 100 ショットず つ重ねどりしたものである.

上の図は、IPフィルム上の電子スペクトルで、 上端はエネルギーゼロ、下端が29 MeVに対応 する。下図は、横軸エネルギーに再プロット したもの.赤は、IP中心線上の生データ、緑 は、IP 縁の背景ノイズをプロットしたもの. 青は、2者の差をとった正味電子スペクトル である.

右側の80 atmの時、14 MeV to 23 MeV に準 単色の電子のコブが見える. 23.3 MeVでの荷 電量は100 ショットで74 fC 、集光角は 2mrad. 但し荷電量は[文献13]に準拠して求め た. IP.13) 65 atm ではこのようばコブは見ら れない。レーザー強度が足らないためと思わ れる. 図12は、右下の図を拡大したもの。



図 13. 図 12 の右下の図を拡大したもの

(3) X 線検出

フォトンカウンティングモードで動作する X 線 検 出 器 (Si-PIN photodiode, XR-100CR, FWHM: 149 eV, Be 窓厚 0.5 mm, Si 厚さ0.5 mm)[®]をレーザー光軸上、2 番目のビームの上 流に設置した. 図9 にあるようにターゲット から散乱される X線は、先ず集光レンズの中 心に開られた直径 8mmの穴を通り、長さ5 cm, 内径 2 mm の鉛コリメーターを通って検出器 に到達する.検出器のエネルギー分解能は 1 チャンネルあたり 35 eV である。コンプトン 散乱光量は平均ショットあたり 0.1 光量子と 予想され、1000 ショットの重ねどりで結果を えた。散乱光のほとんどは電子ビームが周辺 機器に衝突して発生する直接の制動輻射 X 線であり、そのうちコンプトン散乱光は1% 程度である.そのため、2 番目のレーザービ ームの有り無しのデータを図 14 に取り、そ の差をコンプトン散乱光とし図 15 にプロッ トした.



図 14. 軸上後方散乱 X 線 (フォトンカウントモ ード)



生データは、11チャンネル毎(0.385 keV)に 平均して赤点でプロットした。その際の標準 偏差をエラーバーとした.ショット毎のバラ つきはターゲットから1.2mの位置のプラス チックシンチレーターでモニターして補正し た.

図中の青線は、図13から求めた電子ビームス ペクトルをもとに下記の式^{1,2)}

$$\frac{dN_x}{dE_x} = \frac{\alpha_f}{8\varepsilon_I} a_0^2 m_e \gamma N_0 \frac{dN_e}{dE_e} d\Omega \quad (10)$$

を使って求めたものである。この式で α_f は微細構造定数、 N_0 は2番目のレーザーの振動子数、 N_e は衝突電子数を意味する.加速電子のエネルギースペクトルは、

$$m_e \gamma c^2 \frac{dN_e}{dE_e} \tag{11}$$

とした。集光角dΩは50 µstrだった. 図の青線 の5,13,22 keV ピークは、電子ビームの準単 色ピーク14,23 MeVに対応する逆コンプトン 散乱光の計算値である.

赤線の検出されたX線ピークの27と34 keV がこれらに対応する実際の逆コンプトン光と 考えられる。

2keV 以下のX線は、検出器の全面の窓で遮断 されるので、3keVに見えるピークはピークで ない。図15の左側に実験で得られたフォトン 数(赤線)、右側に計算で得られるフォトン数 (青線)をプロットしているが、絶対値は5倍の 範囲内でほぼ一致している事から、実験的に 得られた散乱光は数値的に予測される逆コン プトン散乱光と結論される.

コンプトン光子の導出

今の場合、観測角度 θ は光軸に対して 0 な ので単位立体角あたりの光子数 $dN_x/d\Omega$ は Klein-Nishina formula で簡単に与えられ る. 電子のローレンツファクター は 1 より かなり大きい (γ^2)1)としてよいので,立 体角は小さい ($d\Omega \ll 1$).

$$\frac{dN_x}{d\Omega} = 4\gamma^2 N_e N_p \sigma(\gamma E_L) / S_c \approx 4\gamma^2 N_e N_p r_e^2 / S_c$$
(1)

ここで E_L は入射レーザー光子のエネルギ ー, N_e は衝突する電子の数, N_p は衝突光子数, S_c は衝突面積, σ は Klein-Nishina 断面積. $r_e=e^2/(4\pi \epsilon_0 m_0 c^2)$ は電子の古典半径である. 最大光子エネルギー $E_{max} = 4\gamma^2 \hbar \omega_L$ は前方 輻射の時に与えられる.

加速電子のスペクトルを $N_e \Phi(\gamma) = m_0 c^2 dN_e/dE_e$ と仮定する. ここで N_e は加速バンチの中に含まれる電子の総数である. Eq. (1)を $\Phi(\gamma)$ に渡って積分する。立体角 $d\Omega \approx 20$ µsr の中ではフラットとする. 815 nm レーザーで X-ray photon density は

$$\frac{dN_x}{dE_x} \approx 0.32\gamma N_e N_p r_e^2 \Phi(\gamma) d\Omega / S_c,$$
となる. $E_x = \hbar \omega$ は X-ray の光子エネルギー

で Emax に等しい.

(4) 放射光の空間分布

前節で得られた X 線散乱光がコンプトン散乱 光ならば、レーザー軸の周りだけに局在して いるはずである。それを観測するために、図 16 のように、照射容器の 3 箇所のポートで、 同じ PIN X 線検出器による検出を試みた.



図 16. 空間分布測定のための PIN X 線検出器配置



図17. コンプトン散乱光スペクトルの角度依存性



図18. コンプトン散乱光総量の角度依存性. 点線 は予測計算値.

図18は、図17にあるデータから正味の散乱光 を抜き出して積分したものを角度ごとにぷろ っとしたものである.予測値からするとほと んど0°付近に集まるべきであるが、実際は 30°付近に強い散乱光がみられる.1番目のレ ーザーによる電子ビーム軸と2番目の散乱レ ーザー光軸がズレているためかもしれないが、 実測上はほとんどズレがみられない。散乱光 の空間集光性(空間分布)は継続課題である.

参考文献

1) H. Schwoerer, B. Liesfeld, H.-P. Schlenvoigt, K.-U. Amthor, and R. Sau

erbrey: Phys. Rev. Lett. 96 (2006) 014802.

2) P. Catravas, E. Esarey, and W. P. Leemans: Meas. Sci. Technol. 12 (2001) 1828.

(5) 成果と今後の課題 ①研究成果





図 19.(上)2 段立体構成高出力超短パルスレーザ ー装置図(下)その光学配置図

② 遠隔透視に必要なX線量の推定
 レーザー加速電子と極短パルスレーザー衝突による全光学的構成の逆コンプトン散乱
 X線に成功したが、その発生X線量はまだ微

弱な物である。X線発生量増強を検討するに 当って、まず昨年度発生X線量の定量的推定 と、実用時に必要とされるX線量の推定を行 い、現状レベルの認識、X線増強の目標数値 を明確化する事とした。

③発生X線量の推定(現状把握)

実験レイアウトから、発生X線の検出立体角 は既知である。また対向レーザー有無の実験 でのX線カウント数の差分を取る事により、 高エネルギー電子の制動輻射によるX線量 をキャンセルし、電子ビームー対向レーザー 衝突により発生する逆コンプトン散乱X線 の検出数を推定する事ができる。

これらから、H21年度発生逆コンプトン散乱 X線量は、電子ビーム進行方向で 2.4×10^3 photon/shot/sr と、推定される。

④ 遠隔透視に必要とされるX線量の推定

図 20 は、後方散乱 X 線光子数見積を行う際 の、光源、検出器、透視対象の位置関係、一 次 X 線条件、後方散乱 X 線の検出条件等のモ デル化を示している。厳密に言えば、一次 X 線を対象に向けて走査するため、透視対象物 への一次 X 線の入射角は、対象物中央と端部 では差が生じる。しかし、遠隔透視(離隔距 離 10m 程度を想定)の場合、その偏向角は 数十 mrad と小さく、後方散乱 X 線光子数の 概略評価に影響を与えないため、このモデル では一次 X 線の透視対象への入射は垂直入射 として扱っている。

また、同様に後方散乱 X 線の検出立体角 も厳密に言えば透視対象の中央部、端部で異 なるが、概略検討には影響が無いため中央部



図 20. 後方散乱 X 線光源、検出器、透視対象の 位置関係、一次 X 線条件、後方散乱 X 線の検出条 件等のモデル化

での検出立体角で評価している。図 21 は、

後方散乱X線光子数の計算概要を示したもの である。透視対象の深度 z =0 の点からの後方 散乱X線量に着目すれば、この量は概略以下 のように評価できる。



図 21.後方散乱 X 線光子数の計算概要

(z = z₀からの後方散乱 X 線量)
 = (入射 X 線光子数) x (z=z₀までの
 一次 X 線透過率) x (z=z₀ での所定散乱立
 体角中への散乱確率) x (z=z₀から対象物表
 面に抜けるまでの X 線透過率)







入射X線光子数:1x10⁶/pulse, γ=0.5 を仮定 シンチレータの材質&厚さを適当に選べば、捕集率~100% 検出効率はPMTの量子効率に依存

図 22. 透視対象物のモデル化

X線後方散乱は、ほとんどが X線・電子のコ ンプトン散乱によるものであり、上記式にお ける散乱確率の計算にはクライン - 仁科の 式を用いて計算を行う。透視対象物を図 20 でモデル化し、後方散乱 X線光子数の見積を 行うと、10m遠方の対象物に、一次 X線光 子数として 1X10⁶光子/shotを照射した場合、 直径2mの大面積X線検出器で観測される後 方散乱 X線光子数は図 22中の表のようにな る。この計算結果に示されるように、この条 件で 1shot 当たり数百個の後方散乱 X線光子 が観測されると見積もられる。また、この程 度のX線光子を検出できれば、後方散乱X線 の発生、検出に関わる量子ノイズ(確率的な 揺らぎ)があっても、鉄のような重元素物質 と水のような軽元素物質の境界を後方散乱X 線光子数の差で検出できる可能性が示され ている。したがって、実用レベルの目標とし て10m遠方の物体を分解能5mm程度で透視 することを想定した場合、出射 $\theta = 0^\circ$ 方向 のX線強度として、 10^{12} photon/sr/shot 程度 の強度が必要となる。

以上の検討結果から、原理実証実験レベ ルとして、離隔距離2m、検出器口径10cm (現有検出器サイズ)を想定し、1次元構 造体を対象に、10Hz運転、1時間の積算シ ョットでの画像化を想定した場合(重元素 物質と軽元素物質で後方散乱X線計測数に 有意な差が出る)でも、昨年度発生X線強 度の100倍程度の強度が必要と考えられる。

(6) 今後の目標性能と技術課題

X線エネルギー160keV以上、広がり角6mrad以 下を実現し1m遠方の模擬物体の遠隔断層情 報が取得可能である事を実証する。そのため の技術課題を下記表に纏める.

	秋1.1	又前味愿と匡成反
	技術課題	達成レベル
1	指向性が良く	エネルギー>160 keV
	高強度のペン	指向性(広がり角)<6 mrad
	シルビームX	繰り返し>0.5Hz
	線の実証(重	
	要課題)	
2	遠隔での模擬	離隔距離>1m
	物体の検知の	計測時間分解能<200ps
	実証(重要課	断層分解能<3cm
	題)	遮蔽体厚さ>1cm
3	スキャニング	水平スキャンレンジ>±20°
	可能な照射装	垂直スキャンレンジ>0-20°
	置の小型化	分解能<0.2°
4	2D透視情報	1m離隔,1cmの土砂遮蔽体で模
	取得の実証	擬物体(20cmプラスチック)の
		透視情報取得

表1. 技術課題と達成度

50m遠隔の地中30cm/雪中1mの透視の可能性

雪、ないし水は成分がH,0なので、人体との 識別ができるが、土砂はSi,0が主成分のため、 人体との識別が難しく、実用化上の課題であ る。



図 23. 雪中(上)、"土砂中(下)の人体からの 後方散乱光強度:赤点が人体有り、黒点は人体な しの場合.

5. 主な発表論文等

(研究代表者、研究分担者及び連携研究者に は下線)

〔雑誌論文〕(計10件)

[1] <u>Yoneyoshi Kitagawa, Yoshitaka Mori, Hajime Kuwabara,</u> Shuji Ootsuka, Takahiro Makino, Mari Ohta, Tetsuya Suzuki, "Ultra-intense Laser Applications to the Industries at GPI", Advanced Accelerator Concepts (13th Advanced Accelerator Concepts Workshop at Santa Cruz, Cal. 27 July- 2 August 2008) edited by C. B. Schroeder, W. Leemans, and W. Esarey, AIP Conference Proceedings vol.1086, 171-176 (2009). ISBN: 978-0-7354-0617-9

[2] <u>Y. Mori,</u> Y. Sentoku, K. Kondo, K. Tsuji, N. Nakanii, S. Fukumochi, M. Kashihara, K. Kimura, K. Takeda, K. A. Tanaka, T. Norimatsu, Tsuyoshi Tanimoto, H. Nakamura, M. Tampo, R. Kodama, E. Miura, K. Mima, and <u>Y. Kitagawa</u>, "Auto-injection of electrons into a wake field using a capillary with attached cone ", Physics Plasmas, 16, 1231031-1-5 (2009). DOI:10.1063/1.3271152
[3] Shuuji OOTSUKA, <u>Yoshitaka MORI</u>, Takahiro MAKINO, Mari OHTA, <u>Hajime</u>

Yoneyoshi KITAGAWA KUWABARA, "Influence of femtosecond laser generated X-ray irradiation on germination of Aspergillus Awamori ", The Review of Laser Engineering , 38, 386-388 (2010). [4] 関根尊史,川嶋利幸,佐藤仲弘,高木勝、菅 博文,北川米喜,森 芳孝,花山良平,沖原伸一 郎,藤田和久,石井勝弘,中村直樹、宮本康司, 東 博純,元廣友美,日置辰視, "高繰り返し 高強度レーザー HAMA の開発と DD 核融合中 性子の発生",レーザー学会第 407 回研究 会報告「短波長光の発生とその応用」 No. RTM-10-56, 2010, 12, pp. 17-21 (2010). [5] Y. Mori †, K. Fujita, R. Hanayama, K. Ishii, Y. Kitagawa, H. Kuwabara, T. Kawashima, "INVERSE COMPTON SCATTERING BY LASER ACCELERATED ELECTRONS AND **APPLICATION** STANDOFF ITS TO DETECTION OF HIDDEN OBJECTS". Proceedings of IPAC ' 10, Kyoto, Japan, Published by the IPAC'10 OC/ACFA (23-28 May 2010 at Kyoto International Conference Center) THPD054, pp.4404-4406(2010) on WEB site. [6] Yoneyoshi Kitagawa, Yoshitaka Mori, Ryohei Hanayama, Shinichiro Okihara, Kazuhisa Fujita, Katsuhiro Ishii, Toshiyuki Kawashima, Nakahiro Sato, Takashi Sekine, Ryo Yasuhara, Masaru Takagi, Naoki Nakamura, Yasushi Miyamoto, Hirozumi Azuma, Tomoyoshi Motohiro, Tatsumi Hioki and Hirofumi Kan. "Efficient fusion neutron generation using 10 TW high-repetition rate diode-pumped laser", Plasma and Fusion Research: Letters , 6 , 1306006 (2011). DOI: 10.1585/ pfr.6.1306006 [7] Y. Kitagawa*, Y. Mori, O. Komeda, K. Ishii, R. Hanayama, K. Fujita, S. Okihara, T. Sekine, N. Satoh, T. Kurita, M. Takagi, T. Kawashima, H. Kan, N. Nakamura, T. Kondo, M. Fujine, H. Azuma, T. Motohiro, T. Hioki, Y. Nishimura, A. Sunahara, and Y. Sentoku, "Fusion Using Fast Heating of a Compactly Imploded CD Core", Phys. Rev. Lett. 108, 155001 (2012) [5 pages]. DOI: 10.1103/PhysRevLett.108.155001 [8] Yoshitaka Mori, Hajime Kuwabara, Katsuhiro Ishii, Ryohei Hanayama, Toshiyuki Kawashima, Yoneyoshi Kitagawa "Head-On Inverse Compton Scattering X-rays with Energy Beyond 10 keV from Laser-Accelerated Quasi-Monoenergetic Electron Bunches", Applied Physics Express 5, (2012)056401. DOI: 10.1143/APEX.5.056401 [9] Y. Mori and Y. Kitagawa, "Acceleration of cone-produced electrons by double-line Ti -sapphire laser beating", Physics of Plasmas 19, 053106-1-6 (2012). http:// dx.doi.org/ 10.1063/ 1.4707390 [10]レーザー装置を用いた科学研究の新展開3. 超高強度レーザーのもたらす可能性"プラズマ

核融合学会誌(J.Plasma Fusion Res. 86, No. 10, 582-588 (2010).

〔学会発表〕(計3件)

[1] 北川米喜,森 芳孝, 藤田和久、桑原一, <u>石井勝弘,花山良平,川嶋利幸、</u> レーザ ー加速電子によるレーザー光の逆コンプトン 散乱エックス線発生と遠隔透視応用"日本物 理学会第65回年次大会平成22年3月22 日岡山大学 [2] 森芳孝, 桑原一,藤田和久, 石井勝弘, 花山良平,川嶋利幸,北川米喜 レーザー加速電子によるレーザー逆コンプト ン散乱X 線発生と遠隔透視応用 プラズマ核融合学会第27回年会 2010.11.30-12.4札幌市北海道大学 [3] 森芳孝, 桑原一, 石井勝弘, 花山良平, 川 嶋利幸, 北川米喜 "レーザー加速電子によ るレーザー逆コンプトン散乱X 線発生と遠隔 透視応用IV" 日本物理学会第67回年次大会 2012.3.24-3.27. 関西学院大学 〔産業財産権〕 ○出願状況(計2件) 名称:電子加速装置 発明者:桑原 一,河口 紀仁, 渕上 健児, 北川 米喜,森 芳孝 権利者: IHI 株式会社 種類:特許 H05H 1/00 番号:特願 2010-108068 出願年月日: 2010年5月10日 国内外の別:国際 名称:核融合ターゲット材、核融合装置、 及び核融合方法 発明者: 関根尊史、川嶋利幸, 菅博文、北川米 喜, 森芳孝, 東博純, 日置辰視, 元廣友美、宮本康 司、中村直樹 権利者:浜松ホトニクス株式会社、トヨタ自 動車株式会社 種類: 特許 G21B 1/15(2006.01), G21B 1/03(2006.01) 番号: PCT/JP2010/072573 出願年月日: 2010年12月15日 国内外の別:国際 ○取得状況(計2件) 名称:遺伝子改変装置 発明者:北川米喜 権利者:学校法人光産業創成大学院大学 種類:特許 G21K 5/00 番号:特許第4713362号

```
取得年月日:平成23年4月1日
国内外の別:国内
名称:核融合燃料保持部材及び核融合燃料カプ
セル
発明者:北川米喜
権利者:学校法人光産業創成大学院大学
種類:特許 GPI2006011
番号:特許第4989301号
取得年月日:平成24年5月11日
国内外の別:国内
[その他]
ホームページ等
http://www.gpi.ac.jp/
6. 研究組織
(1)研究代表者
 北川 米喜 (KITAGAWA YONEYOSHI)
 光産業創成大学院大学・光産業創成研究
 科·教授
 研究者番号:40093405
(2)研究分担者
 森 芳孝 (MORI YOSHITAKA)
 光産業創成大学院大学・光産業創成研究
 科·助教
 研究者番号:60440616
 藤田 和久 (FUJITA KAZUHISA)
 光産業創成大学院大学・光産業創成研究
 科·准教授
 研究者番号: 30410533
 石井 勝弘 (ISHII KATUHIRO)
 光産業創成大学院大学・光産業創成研究
 科·准教授
 研究者番号: 30311517
 花山 良平 (HANAYAMA RYOUHEI)
 光産業創成大学院大学・光産業創成研究
 科·助教
 研究者番号:20418924
(3)連携研究者
 桑原 一 (KUWABARA HAJIME)
 株式会社 IHI · 技術開発本部
 川嶋 利幸 (KAWASHIMA TOSHIYUKI)
 浜松ホトニクス株式会社・大出力レーザー
```

開発部·部長代理